



Серия PVD

Система нанесения тонких пленок

PVD-10



Эффективность

Экономичность

Эргономика

Магнетронное распыление

Термическое испарение

Гибридная конфигурация



PVD-10

PVD-10 – компактная система, позволяющая одинаково качественно проводить процессы термического осаждения из паровой фазы или путем распыления мишени. Благодаря своему дизайну идеально подходит для лабораторий и повседневных научно исследовательских задач.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- D-образная камера из нержавеющей стали с иллюминатором
- До 10 вращающихся подложкодержателей
- Переключатель источников
- Конфигурируемый подложкодержатель
- Возможность работы с пластинами диаметром до 4-х дюймов (100мм)
- Возможность установки 2-х кварцевых датчиков



ПРИМЕНЕНИЕ

- **БИОМЕДИЦИНСКОЕ**
- **ПОЛУПРОВОДНИКОВОЕ**
- **ФОТОВОЛЬТАИКА**
- **ОПТОЭЛЕКТРОНИКА**
- **СТЕКЛОКЕРАМИКА**
- **МЕТАЛЛИЗАЦИЯ**

МЕТОДЫ ОСАЖДЕНИЯ

ТЕРМИЧЕСКИЕ

- Испарители типа «лодочка, корзина, спираль итд.»
- Возможность разместить до 10 испарителей
- Система защиты от перекрестного напыления
- Органика 2сс/Неорганика

ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ ИСТОЧНИК

- Электронно-лучевая бомбардировка
- 4-х ячейчный тигель (объем ячеек бсс)

МАГНЕТРОННЫЕ

- 1" и 4" магнетронные источники
- Интегрированные заслонки
- ВЧ, постоянного тока, постоянного тока с режимом пульсации блоки питания
- До 4-х магнетронов размещенных сверху или снизу камеры
- Датчики потоков газов с регуляторами
- Регулировка давления дроссельной заслонкой

ГИБРИДНЫЕ

- Совмещение термических и магнетронных процессов
- Контроль процесса с помощью фирменного ПО

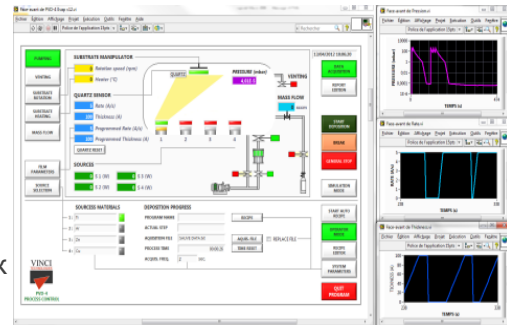


ПРОСТОЕ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Система предназначена для научно исследовательских задач, комплектуется программным обеспечением, позволяющим обеспечить автоматический контроль параметров во время процесса

Возможности программного обеспечения:

- Контроль скорости осаждения
- Контроль толщины
- Контроль вакуума
- Температурный контроль
- Контроль функций клапанов и заслонок



Полуавтоматический и полностью автоматический контроль

Режимы уровней пользовательского доступа

Программирование последовательностей процессов с возможностью сохранения/загрузки

Аппаратная часть на базе ПК под управлением Windows 7

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Равномерность (@ рабочая дистанция около 200 мм)	+/-2%
Точность определения толщины	0.1 Å
Точность определения скорости напыления	0.01 Å
Базовое давление	10 ⁻⁷ mbar
Скорость откачки (10 ⁻⁶ mbar)	< 20 mins.
Турбомолекулярная откачка	700 L/s on N ₂

ОПЦИИ



- Нагрев подложкодержателя до 600°C



- Смещение на образец



- Ионные источники

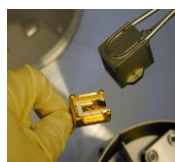


ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

Функция	СИСТЕМА		
	PVD-10 E	PVD-10 S	PVD-10 H
Нагрев подложки (до 600 ° C)	X	X	X
Охлаждения подложки (до -150 ° C)	X	X	X
Вращения подложки	X	X	X
Магнетроны (до 4-х)	-	X	В зависимости от количества термических источников
Расположение магнетронов снизу	-	X	-
Расположение магнетронов сверху	-	X	X
Термические источники (до 10)	X	-	В зависимости от количества магнетронных источников
Шлюзовый загрузчик	X	-	X
Изолирование держателя подложки для подачи смещения	-	X	X
Ионный источник	-	-	X
Возможность регулирования рабочего давления	-	X	X

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Быстрая скорость откачки
- Управление вакуумом
- Контроль толщины
- Экономичность
- Гибкая конфигурация
- Компактность



ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

Компания Vinci Technologies производит и поставляет широкий спектр лабораторных и полевых приборов для нефтяной и газовой промышленности. Вакуумное подразделение, ранее MECA2000 основана на богатом опыте в производстве PVD оборудования для напыления и термического испарения, а также PECVD систем для вакуумного покрытия тонких неорганических и органических пленок.

Для получения дополнительной информации, обращайтесь в наш каталог в режиме онлайн или свяжитесь с нами для консультации.